1



traç	o e ultra-traço				
	Definição do elemento	Concentração	Unidade SI	Unidade usual	
	Majoritário	>1%	g/L ou g/kg	%	
	Minoritário	1-0,01 %	mg/L ou mg/kg	ppm	
	Traço	0,01-0,0001 %	μg/L ou μg/kg	ppb	
	Ultra-traco	<0,0001 %	ng/L ou ng/kg	ppt	



 1970 – ppb – Compostos policíclicos aromáticos (HPAs) "Agulha num palheiro"

 1980 – ppt – Dioxina em leite
 "Lente de contato em uma praia de 150 km"







JAAS, 27: 1173, 2012

Histórico da técnica

• Técnica relativamente recente:

Houk, Fassel, Flesch, Svec, Gray & Taylor – Analytical Chemistry, 52: 2283, 1980.

1983: 1º equipamento comercial **1992:** 500 ICP-MS's **1996:** 2.000 ICP-MS's **2001:** 4.000 ICP-MS's **2012:** 11.000 ICP-MS's **2018:** 18.000 ICP-MS's

https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/an-introduction-to-inductively-coupledplasma-mass-spectrometry-for-measuring-heavy-metals-in-pharmaceuticals-0001

R. Thomas, Practical guide to ICP-MS, 3ed, 2013.























PERPENDICULAR (90°)



























ICP-MS: Limitações

- Baixa tolerância a sólidos dissolvidos (<0.1%) e acidez (<5%)
- Dificuldade para elementos com altas energias de ionização
- Custo de aquisição mais elevado (ICP-MS ≈ \$150K, ICP OES ≈ \$90K, FAAS ≈ \$20K)
- Custo operacional mais elevado (consumíveis, manutenção)
- Requer maior perícia do analista
- Interferências (matriciais e espectrais)

Tipos de interferências matriciais

- Altos teores de C (amostras orgânicas) e sólidos dissolvidos
- Desestabilização do plasma
- Deposição e obstrução dos cones
- Elementos facilmente ionizáveis (EIE)
- Alteração no equilíbrio do plasma
- Supressão na ionização dos analitos
- Interferências físicas
- Efeitos de transporte
- Efeitos na nebulização

- Efeitos de carga espacial
- Elementos leves

Correções de interferências matriciais

- Diluição da amostra
 - Sólidos dissolvidos < 0,1% e baixos teores de C
- Uso de mistura Ar/O₂ no gás auxiliar
 - Decomposição de matrizes orgânicas
- Compatibilização dos padrões
 - Amostras menos complexas
- Calibração por adição de padrão
 - Amostras complexas
- Uso de padrão interno
 - Interferências de transporte e possivelmente de carga espacial

Tipos de interferências espectrais

- Sobreposições isobáricas
 - Diferentes elementos com a mesma m/z
- Ex: ⁴⁰Ca⁺ (96.9%) e ⁴⁰Ar⁺ (99.6%) ; ⁶⁴Zn⁺ (48.6%) e ⁶⁴Ni⁺ (0.29%)
- Íons com dupla carga
 - Separação por m/z: Íon divalente interfere no analito com metade da m/z
- Ex: ¹³⁸Ba⁺² (71.7%) em ⁶⁹Ga⁺ (60.1%) ; ¹⁴⁰Ce⁺² (88.5%) em ⁷⁰Ge⁺ (21.2%)



Correção de interferências espectrais

- Seleção de isótopos alternativos
- \downarrow abundância, \downarrow sensibilidade
- monoisotópicos?

• Plasma frio

- \downarrow potência RF, \downarrow temperatura, \downarrow Ar⁺
- Menos interferências, porém \downarrow formação de M $^{\scriptscriptstyle +}$

• Aplicação de equações de correção

- Medidas do interferente em isótopos alternativos
- Limitada a interferências poliatômicas mais brandas

Correção de interferências espectrais

- Uso de equipamentos de alta resolução
- Alto custo
 - ICP-QMS ≈ US\$150K
 - SF-ICP-MS ≈ US\$270K
- \uparrow resolução, \downarrow sensibilidade

• Emprego de arranjos especiais

- Celas de dinâmicas de reação
- Celas de colisão
- Configuração tandem (MS/MS ou Triplo quadrupolo)







Exercício em aula

Um analista deseja determinar a concentração de Cu e Ni em amostras de água do mar (salinidade = 3,5% m/v) por ICP-MS, sabendo que as mesmas se encontram na faixa de µg/L a ng/L. Considerando as possíveis interferências que podem ser observadas nesse problema analítico, proponha uma alternativa para a determinação de Cu e Ni com boa exatidão e precisão

Elemento	Abundância	Interferências
⁵⁸ Ni ⁺	68 %	⁴⁰ Ar ¹⁶ O ⁺ ; ²³ Na ³⁵ Cl ⁺
⁶³ Cu ⁺	69%	$^{12}\mathrm{C}^{16}\mathrm{O}^{35}\mathrm{Cl^{+}}\text{; }^{23}\mathrm{Na}^{40}\mathrm{Ar^{+}}$

<u>Efeitos de matriz:</u> Salinidade alta, elementos facilmente ionizáveis Correção: Compatibilização de matriz, Adições de padrão, Padronização interna

Interferências espectrais: Poliatômicos

Não funcionariam: Plasma frio, diluição, isótopo alternativo equação de correção Correção: Celas de reação e colisão











<section-header><section-header><section-header><section-header><image><image><image>



Modos de reação e	Mode	Intensity <i>m/z</i> 129	Sensitivity ¹²⁷ l (kcps/ppb)	BEC (ppt)	LOD (ppt)
modos de reação e	STD	2480	52.8	46.9	6.9
colisão	KED	237	4.9	48.3	49.3
consuo	CCT	44	49.4	0.89	0.08

- O modo padrão (STD) apresenta interferência espectral
- O modo KED é ineficiente na correção de sobreposição isobáricas (átomos com o mesmo tamanho). Sensibilidade e LOD são prejudicados

51

• O modo CCT propicia a reação:

 129 Xe + O₂ \rightarrow 129 Xe¹⁶O (m/z = 145)

- Determinação do ¹²⁹I livre de interferências e com baixíssimo LOD



ICP-MS para fluidos biológicos

A fully quantitative research method for the analysis of lead in whole blood using the Thermo Scientific iCAP Q ICP-MS



- Amostras desafiadoras para análise por ICP-MS:
- Viscosidade e densidade Comprometem o transporte/nebulização
- Teores elevados de C Deposição nos cones e interferências poliatômicas

para alguns elementos

- Alto teor de sais – Introdução de amostra e interferências de matriz

Dilution Factor	Pb Meas. (µg/L)	D.F. Corr. (µg/dL)	Certified Value (ug/dL)	% Recovery
1000	0.085	8.51	8.14	105
100	0.810	8.10	8.14	100
1000	0.079	7.89	8.14	97
100	0.854	8.54	8.14	105
1000	0.083	8.28	8.14	102
100	0.794	7.94	8.14	98

• Alta sensibilidade torna possível o emprego de diluições de 100-1000X com boa exatidão e precisão.



53

ICP-MS para análises que envolvam alta pureza

Determination of ultra trace elements in semiconductor grade Isopropyl Alcoho (IPA) by high sensitivity ICP-MS



54

• Desafios analíticos para análise de reagentes para semicondutores:

- Contaminantes em baixíssimas concentrações (alta sensibilidade)

58

Parameter	Value		-			
Hot plasma power	1350 W		Analysis Made	BEC	Le0 (act)	Recovery
Cold plasma power	800 W	U	Cold	0.031	0.007	99%
Spray chamber	Quartz cyclonic	18	Hot	107	29	89%
Peltier temperature	-10 °C	=Na	Cold	10	LeO 1 0.007 200 0.8 0.54 0.34 0.34 1.6 0.34 1.6 0.000 0.52 1.2 1.2 1.2 1.6 0.000 0.34 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	101%
Hot plasma nebulizer gas flow	0.7 L/min	PMg	Cold	0.78	0.54	101%
 Cold plasma netulizer cas flow 	1.0 L/min	P'Al	Cold	0.29	0.34	97%
çao Doran das Baw	50 ml Imin	^a K	Cold	14	0.31	97%
Natural State	Minister DEA 100 Inst appretion	*Ca	Cold	1.4	3.1	118%
Part Adams	Million Mill Privito pen-aspirating	10%	POL.	4.0	1,4	0.7%
injector	1.0 mm I.D., quartz	Hate	Cold	73	16	07%
Pitertace	Platnum sampler and high sensitivity clatics in skimmer	HE-	Cold	37	0.000	98%
David Sens	100 mm par park 10 masters	10NE	Cold	0.40	0.52	97%
CAMER GLOB	Too ma per prais, to service	¹⁰ Co	Cold	1.9	1.2	103%
		. HOGU	Cold	5.0	2.4	106%
de introdução, de :	amostras	^{se} Zn	Cold	6.5	3.7	109%
ac introdução ac	amostras	"Ge	Hat	5.1	3.9	90%
3-10 μL/min) – Mer	nor carga	"As	Hot	7.6	11	107%
1 2 2	8	"Ag	Cold	0.41	0.42	116%
		="Cd	Hot	0.26	0.39	104%
		1480	Cold	0.01	0.04	100%
		50	762	0.10	0.001	10.0%
	ma Cal plana power Cal plana power Spay chamber plana extension Cal plana notoclar gas from Cal plana notoclar gas from Cal plana notoclar gas from Cal plana notoclar gas from Netrolor Netrolor biotor b	Parameter Value Hitt plasma power 1350 W Cold plasma power 800 W Spay damble Quart cyclonic Plasma power 0.0 W Spay damble Quart cyclonic Plasma notular gas flow 0.1 Unin Cold plasma notular gas flow 0.1 Unin Cold plasma notular gas flow 50 mL/min Nate of the second	ma At planna power 1350 W Cold planna power 0400 W Spray dramber OGuart cyclonic Piller Spray dramber Oguart cyclonic Piller Spray dramber Oguart Cyclonic Piller Spray dramber Oguart Oguart Oguart Net planna nobulker gas from 0.7 L/min Oguart planna nobulker gas from 0.7 L/min Oguart planna nobulker gas from 0.7 L/min Net Actar Net Ac	Parameter Value Hst planna power 1350 W Cold planna power 000 W Gold planna power 000 W Cold planna power 000 W Spray drankow Outre to politike 10° C Hst planna notoblar gas flow 0.7 Umin Ood planna notoblar gas flow 0.7 Umin Ood planna notoblar gas flow 0.7 Umin Not Cold Viet planna notoblar gas flow 50 m.Cmin Memory Douget asplanting Not Cold Not Cold Viet fore 10 mm ILD, quart Memory Douget asplanting Not Cold Not Cold Viet fore 100 mm Dup pross, 10 memory Not Cold Not Cold Not Cold Viet fore 100 mm Dup pross, 10 memory Not Cold Not Cold Not Cold Viet fore 100 mm Dup pross, 10 memory Not Cold Not Cold Not Cold Viet fore 100 mm Dup pross, 10 memory Not Cold Not Cold Not Cold Viet fore 100 mm Dup pross, 10 memory Not Cold Not Cold Not Cold Viet fore 100 mm Dup pross, 10 memory Not Cold Not Cold </td <td>Parameter Value Ht & plasma power 1350 W Gdz plasma power 800 W Spray charber Guato cyclosic Plate interpretate Guato cyclosic Ht plasma nobulkor pas flow 0.1 U/min Gdz plasma nobulkor pas flow 0.1 U/min Gdz plasma nobulkor pas flow 0.1 U/min Methodar Bit On L/min Nethodar Dimension pas flow Methodar Dimension pas flow <</td> <td>Parameter Value Hst planna power 1350 W Cold planna power 600 W Spray tharbor Quart cyclonic Parameter 0°C Spray tharbor Quart cyclonic Hst planna nobultur gas flow 0.7 L Unin Cold planna nobultur gas flow 0.7 L Unin Cold planna nobultur gas flow 0.7 L Unin Data planna nobultur gas flow 0.0 L/L Inin Cold planna nobultur gas flow 0.0 L/L Inin Data planna nobultur gas flow 0.0 L/L Inin Viet duar 1.0 Inin</td>	Parameter Value Ht & plasma power 1350 W Gdz plasma power 800 W Spray charber Guato cyclosic Plate interpretate Guato cyclosic Ht plasma nobulkor pas flow 0.1 U/min Gdz plasma nobulkor pas flow 0.1 U/min Gdz plasma nobulkor pas flow 0.1 U/min Methodar Bit On L/min Nethodar Dimension pas flow Methodar Dimension pas flow <	Parameter Value Hst planna power 1350 W Cold planna power 600 W Spray tharbor Quart cyclonic Parameter 0°C Spray tharbor Quart cyclonic Hst planna nobultur gas flow 0.7 L Unin Cold planna nobultur gas flow 0.7 L Unin Cold planna nobultur gas flow 0.7 L Unin Data planna nobultur gas flow 0.0 L/L Inin Cold planna nobultur gas flow 0.0 L/L Inin Data planna nobultur gas flow 0.0 L/L Inin Viet duar 1.0 Inin

="Au =='() Hot 1.0 0.07

Cold Cold 86%

1.4

0.39 99%

 Operação no modo normal para elementos com elevada energia de ionização - Melhor performance analítica

APLICAÇÕES
Forense
CRIVE SCEVE DO WOIL CROSS



IPEN - CNEN/SP, Instituto de Criminalistica de São Paulo

ro/Marco 200

IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS DE DISPAROS DE ARMAS DE FOGO POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM FONTE DE PLASMA INDUTIVO

Edson Luis Tocala dos Reis, Jorge Eduardo de Souza Sarkis¹*, Claudio Rodrigues aldo Negrini Neto?* Sonia Viebia²

> Coleta com algodões embebidos em solução de EDTA Comparação antes e depois do disparo











				+	%		+	%
ANALYTE	UNITS	DL	SAMPLE	SPIKE	REC	SAMPLE	SPIKE	REC
10B	ppb	1	2.0	26.0	108	1.7	17.9	98
²⁴ Mg	ppb	0.2	4.1	28.4	110	9.3	27.0	108
27AI	ppb	1	8.4	27.8	87	9.4	27.7	112
⁴⁰ Ca	ppb	0.6	12.6	37.1	110	7.3	25.4	110
48Ti	ppb	0.3	3.5	26.8	105	11.4	27.8	100
51V	ppb	0.06	1.6	25.4	107	9.8	25.8	98
52Cr	ppb	0.2	5.7	30.7	112	12.4	30.2	109
55Mn	ppb	0.2	2.2	25.8	106	9.0	25.5	100
56Fe	ppb	0.8	14.8	39.7	112	18.4	35.3	104
60Ni	ppb	0.2	3.1	28.4	114	12.3	28.7	100
63Cu	ppb	0.6	10.1	33.9	107	15.9	32.1	99
66Zn	ppb	0.4	102	124	98	132	146	84
98Mo	ppb	0.01	1.5	24.4	103	6.9	22.4	95
107Ag	ppb	0.02	0.7	23.6	103	3.7	19.4	96
111Cd	ppb	0.04	2.7	24.5	98	10.2	24.7	88
¹³⁸ Ba	ppb	0.04	1.8	23.2	97	8.6	22.8	86
²⁰⁸ Pb	ppb	0.3	4.7	26.1	96	8.4	22.0	83